P24816.P04

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Akira YAMAMOTO et al.

Serial No.:

Not Yet Assigned

Filed

Concurrently Herewith

For

METHOD FOR CULTURING CELLS, CELL CULTURE CARRIERS AND CELL

CULTURE APPARATUS

CLAIM OF PRIORITY

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 based upon Japanese Application No. 2003-107143, filed April 10, 2003 and Application No. 2003-107144, filed April 10, 2003. As required by 37 C.F.R. 1.55, certified copies of the Japanese applications are being submitted herewith.

Respectfully submitted,

Akira YAMAMOTO et al.

Bruce H. Bernstein

Reg. No. 29,027

Lpo. 33,0

April 12, 2004 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1950 Roland Clarke Place Reston, VA 20191 (703) 716-1191

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 4月10日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-107143

[ST. 10/C]:

[JP2003-107143]

出 願 人
Applicant(s):

ペンタックス株式会社

2004年 1月 9日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井原



【書類名】 特許願

【整理番号】 15P139

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B01J 20/04

【発明者】

【住所又は居所】 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株

式会社内

【氏名】 山本 晃

【発明者】

【住所又は居所】 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株

式会社内

【氏名】 菅生 健

【発明者】

【住所又は居所】 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株

式会社内

【氏名】 黒澤 八重

【発明者】

【住所又は居所】 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株

式会社内

【氏名】 木城 きくか

【特許出願人】

【識別番号】 000000527

【氏名又は名称】 ペンタックス株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091292

【弁理士】

【氏名又は名称】 増田 達哉

【電話番号】 3595-3251

【選任した代理人】

【識別番号】

100091627

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝比 一夫

【電話番号】

3595-3251

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007593

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0104391

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 細胞培養担体、細胞培養方法および細胞培養装置【特許請求の範囲】

【請求項1】 細胞を表面に付着させ、増殖させる細胞培養担体であって、 磁性粒子と、該磁性粒子の表面の少なくとも一部を覆うように形成され、前記 細胞が付着し得る被覆層とを有することを特徴とする細胞培養担体。

【請求項 2 】 前記細胞培養担体の密度は、 $0.8 \sim 2.5 \text{ g/c m}^3$ である請求項 1 に記載の細胞培養担体。

【請求項3】 前記細胞培養担体の平均粒径をA $[\mu m]$ とし、前記細胞培養担体に付着させる細胞の最大長さをB $[\mu m]$ としたとき、A/Bが2~100である請求項1または2に記載の細胞培養担体。

【請求項4】 前記細胞培養担体の平均粒径は、50~500μmである請求項1ないし3のいずれかに記載の細胞培養担体。

【請求項5】 前記被覆層は、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成されている請求項1ないし4のいずれかに記載の細胞培養担体。

【請求項6】 前記被覆層は、前記磁性粒子の表面付近に、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成された粒子の一部が貫入することにより形成されたものである請求項5に記載の細胞培養担体。

【請求項7】 前記被覆層は、前記磁性粒子の表面に、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成された多孔質粒子を衝突させることにより形成されたものである請求項6に記載の細胞培養担体。

【請求項8】 前記磁性粒子は、樹脂材料と磁性材料とを複合化してなるものである請求項1ないし7のいずれかに記載の細胞培養担体。

【請求項9】 請求項1ないし8のいずれかに記載の細胞培養担体と、細胞とを含む培養液へ磁場を与え、前記培養液中で前記細胞培養担体を移動させることにより、前記培養液を撹拌するとともに、前記細胞を前記細胞培養担体の表面に付着させ、増殖させることを特徴とする細胞培養方法。

【請求項10】 前記培養液へ与える磁場の強度を、経時的に変化させる請求項9に記載の細胞培養方法。

【請求項11】 前記培養液へ与える磁場の位置を、経時的に変化させる請求項9または10に記載の細胞培養方法。

【請求項12】 請求項9ないし11のいずれかに記載の細胞培養方法に用いることを特徴とする細胞培養装置。

【請求項13】 請求項1ないし8のいずれかに記載の細胞培養担体と、細胞とを含む培養液を収納する培養容器と、

前記培養液中で前記細胞培養担体を移動させるための磁場を発生する磁場発生 装置とを有することを特徴とする細胞培養装置。

【請求項14】 前記磁場発生装置は、発生する磁場の強度を経時的に変化させるよう構成されている請求項13に記載の細胞培養装置。

【請求項15】 前記磁場発生装置は、発生する磁場の位置を経時的に変化させるよう構成されている請求項13または14に記載の細胞培養装置。

【請求項16】 前記磁場発生装置は、前記培養容器の外周部に設けられている請求項13ないし15のいずれかに記載の細胞培養装置。

【請求項17】 前記磁場発生装置は、前記培養液に接触して設けられている請求項13ないし15のいずれかに記載の細胞培養装置。

【請求項18】 前記磁場発生装置は、前記培養容器内に収納された前記培養液の液面付近に設けられている請求項13ないし17のいずれかに記載の細胞培養装置。

【請求項19】 前記磁場発生手段を複数個有する請求項13ないし18のいずれかに記載の細胞培養装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、細胞培養担体、細胞培養方法および細胞培養装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、細胞培養技術が、細胞組織工学、医薬品等の安全性試験、治療や診断を

目的としたタンパク質の生産等、様々な産業、研究分野で応用されている。

[0003]

現在、この細胞培養には、付着依存性細胞を大量に効率よく培養するために、 培養フラスコによる平面培養ではなく、細胞の足場となるビーズ状の担体を用い た三次元高密度培養(マイクロキャリヤー培養)が用いられている。

[0004]

このマイクロキャリヤー培養には、各種の担体(細胞培養担体)が用いられている。

[0005]

ところで、マイクロキャリヤー培養では、担体を均一に懸濁させ、付着させた 各細胞に偏りなく栄養を供給するため、細胞培養を行っている間は、培養液を十 分に撹拌することが重要となる。

[0006]

これまで、このマイクロキャリヤー培養には、一般に、羽根 (フィン) が形成された撹拌子を用い、これを回転させながら培養液の撹拌を行うスピンナーフラスコが使用されている (特許文献 1 参照)。

[0007]

しかしながら、スピンナーフラスコを用いるマイクロキャリヤー培養では、撹拌子の回転速度が速過ぎると、羽根と担体とが激しく衝突して細胞が担体から脱落したり、破壊されてしまう場合があり、細胞を十分に増殖させることができない。一方、撹拌子の回転速度が遅過ぎると、担体がスピンナーフラスコ中で沈んでしまい、培養液中に均一に懸濁されない。このような場合、細胞への栄養供給に偏りが生じ、期待する程の増殖率が得られないため、攪拌子を適度な回転速度で回転させることが極めて重要となる。

[0008]

ところが、スピンナーフラスコを用いるマイクロキャリヤー培養では、攪拌子 を適度な回転速度で回転させることが非常に難しいという問題がある。また、用 いる細胞の種類やフラスコの形状等に応じて、培養条件(攪拌子の回転速度等) の設定が必要であるという問題もある。 [0009]

【特許文献1】

特開平06-209761号公報

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、均一かつ緩やか(マイルド)に培養液を撹拌することができ 、細胞を効率よく付着、増殖させることができる細胞培養担体、かかる細胞培養 担体を用いる細胞培養方法および細胞培養装置を提供することにある。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

【課題を解決するための手段】

このような目的は、下記 $(1) \sim (19)$ の本発明により達成される。

[0012]

(1) 細胞を表面に付着させ、増殖させる細胞培養担体であって、

磁性粒子と、該磁性粒子の表面の少なくとも一部を覆うように形成され、前記 細胞が付着し得る被覆層とを有することを特徴とする細胞培養担体。

[0013]

本発明によれば、均一かつ緩やかに培養液を撹拌することができ、細胞を効率 よく付着、増殖させることができる。

[0014]

(2) 前記細胞培養担体の密度は、0.8~2.5g/cm³である上記(1)に記載の細胞培養担体。

これにより、培養液の撹拌を十分に行うことができる。

[0015]

(3) 前記細胞培養担体の平均粒径を $A [\mu m]$ とし、前記細胞培養担体に付着させる細胞の最大長さを $B [\mu m]$ としたとき、A / Bが $2 \sim 1$ 00 である上記(1)または(2)に記載の細胞培養担体。

[0016]

これにより、細胞培養担体の表面積を細胞の大きさ(サイズ)に対して十分に 大きくすることができるため、細胞が細胞培養担体の表面に付着、増殖するのが より容易となる。

[0017]

(4) 前記細胞培養担体の平均粒径は、 $50 \sim 500 \mu$ mである上記(1) ないし(3) のいずれかに記載の細胞培養担体。

[0018]

これにより、細胞が細胞培養担体の表面に付着、増殖するのがより容易となるとともに、細胞培養担体を培養液中でより均一に懸濁させることができる。

[0019]

(5) 前記被覆層は、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成されている 上記(1)ないし(4)のいずれかに記載の細胞培養担体。

[0020]

リン酸カルシウム系化合物は、生物学的に不活性であり、細胞に対してダメージを与えるおそれが極めて低いことから好ましい。

[0021]

(6) 前記被覆層は、前記磁性粒子の表面付近に、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成された粒子の一部が貫入することにより形成されたものである上記(5)に記載の細胞培養担体。

これにより、被覆層と磁性粒子との密着性を優れたものとすることができる。

[0022]

(7) 前記被覆層は、前記磁性粒子の表面に、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成された多孔質粒子を衝突させることにより形成されたものである上記(6)に記載の細胞培養担体。

かかる方法によれば、容易かつ確実に、被覆層を形成することができる。

[0023]

(8) 前記磁性粒子は、樹脂材料と磁性材料とを複合化してなるものである 上記(1)ないし(7)のいずれかに記載の細胞培養担体。

[0024]

これにより、樹脂材料と磁性材料との配合比率(混合比率)を設定することで、容易に磁性粒子(延いては、細胞培養担体)の密度(比重)を調整することが

できるとともに、細胞培養担体の形状、大きさ(平均粒径等)等の調整が容易となる。

[0025]

(9) 上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の細胞培養担体と、細胞とを含む培養液へ磁場を与え、前記培養液中で前記細胞培養担体を移動させることにより、前記培養液を撹拌するとともに、前記細胞を前記細胞培養担体の表面に付着させ、増殖させることを特徴とする細胞培養方法。

[0026]

本発明によれば、均一かつ緩やかに培養液を撹拌することができ、細胞を効率 よく付着、増殖させることができる。

[0027]

(10) 前記培養液へ与える磁場の強度を、経時的に変化させる上記(9) に記載の細胞培養方法。

これにより、培養液をより均一に攪拌することができる。

[0028]

(11) 前記培養液へ与える磁場の位置を、経時的に変化させる上記(9) または(10)に記載の細胞培養方法。

これにより、培養液をより均一に攪拌することができる。

[0029]

(12) 上記(9)ないし(11)のいずれかに記載の細胞培養方法に用いることを特徴とする細胞培養装置。

[0030]

本発明によれば、均一かつ緩やかに培養液を撹拌することができ、細胞を効率 よく付着、増殖させることができる。

[0031]

(13) 上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の細胞培養担体と、細胞とを含む培養液を収納する培養容器と、

前記培養液中で前記細胞培養担体を移動させるための磁場を発生する磁場発生 装置とを有することを特徴とする細胞培養装置。 [0032]

本発明によれば、均一かつ緩やかに培養液を撹拌することができ、細胞を効率 よく付着、増殖させることができる。

[0033]

(14) 前記磁場発生装置は、発生する磁場の強度を経時的に変化させるよう構成されている上記(13)に記載の細胞培養装置。

これにより、培養液をより均一に攪拌することができる。

[0034]

(15) 前記磁場発生装置は、発生する磁場の位置を経時的に変化させるよう構成されている上記(13)または(14)に記載の細胞培養装置。

これにより、培養液をより均一に攪拌することができる。

[0035]

(16) 前記磁場発生装置は、前記培養容器の外周部に設けられている上記 (13)ないし(15)のいずれかに記載の細胞培養装置。

[0036]

(17) 前記磁場発生装置は、前記培養液に接触して設けられている上記(13)ないし(15)のいずれかに記載の細胞培養装置。

[0037]

(18) 前記磁場発生装置は、前記培養容器内に収納された前記培養液の液面付近に設けられている上記(13)ないし(17)のいずれかに記載の細胞培養装置。

[0038]

これにより、細胞培養担体を上下方向に大きく移動させることができ、培養液 をより均一に撹拌することができる。

[0039]

(19) 前記磁場発生手段を複数個有する上記(13)ないし(18)のいずれかに記載の細胞培養装置。

[0040]

これにより、細胞培養担体の培養液中での移動をより複雑なパターンとするこ

とができる。

[0041]

【発明の実施の形態】

本発明は、細胞を懸濁させた培養液(液体培地)を撹拌しながら、細胞を浮遊 状態で増殖させる撹拌培養に適用される。

[0042]

ここで、この撹拌培養では、特に細胞が付着依存性細胞の場合、細胞とともに 、細胞を付着させる細胞培養担体を培養液中に懸濁し、この細胞培養担体の表面 に細胞を付着させた状態で増殖させることが行われる。

[0043]

細胞培養担体を用いる培養方法は、特にマイクロキャリヤー培養と称され、本 発明は、このマイクロキャリヤー培養に好適に用いることができる。

[0044]

以下、本発明の細胞培養担体、細胞培養方法および細胞培養装置を、マイクロキャリヤー培養に適用した場合を一例として説明する。

[0045]

まず、本発明の細胞培養担体について説明する。

図1は、本発明の細胞培養担体の実施形態を示す断面図である。

[0046]

図1に示す細胞培養担体1は、磁性粒子2と、この磁性粒子2の表面を覆うように形成され、細胞が付着し得る被覆層3とを有している。この細胞培養担体1は、磁場が与えられることにより、培養液中で移動し、培養液を均一かつ緩やか(マイルド)に攪拌する。このため、細胞が細胞培養担体1の表面に付着し易くなるとともに、付着した細胞には、均一に栄養が供給されることになる。したがって、細胞培養担体1は、細胞増殖の良好な足場となる。

[0047]

また、従来のスピナーフラスコを用いた培養のように、羽根と細胞培養担体1 とが衝突して生じる激しい衝撃が細胞培養担体1に加わるのを防止することがで きるので、付着した細胞が細胞培養担体1の表面から脱落することや、細胞が破 壊されるのを防止することができる。

[0048]

磁性粒子2は、細胞培養担体1の骨格を構成する部分である。磁性粒子2は、その全体が磁性材料で構成されたものであってもよいが、樹脂材料と磁性材料とを複合化してなる複合化粒子であるのが好ましい。これにより、樹脂材料と磁性材料との配合比率(混合比率)を設定することで、容易に磁性粒子2(延いては、細胞培養担体1)の密度(比重)を調整することができる。また、細胞培養担体1の形状、大きさ(平均粒径等)等の調整が容易となるという利点もある。

[0049]

この複合化粒子(磁性粒子 2)の形態としては、図1に示すように、主として 樹脂材料で構成された基材 2 1 中に磁性材料(磁性粉体) 2 2 が分散されたもの が好適である。かかる磁性粒子 2 は、例えば、磁性材料 2 2 を混合した溶融状態 の樹脂材料を粒状に成形(造粒)することにより、比較的容易に製造することが できる。なお、複合化粒子は、磁性材料 2 2 が基材 2 1 の表面付近にのみ分散さ れたものであってもよい。

[0050]

この磁性材料22としては、例えば、酸化鉄、Fe、Ni、Co等を主成分とする強磁性合金、フェライト、バリウムフェライト、ストロンチウムフェライト等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0051]

また、樹脂材料としては、各種熱硬化性樹脂、各種熱可塑性樹脂を用いることができ、具体的には、熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイミド、アクリル樹脂、熱可塑性ポリウレタン等、熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、不飽和ポリエステル、アルキド樹脂、熱硬化性ポリウレタン、エボナイド等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0052]

また、樹脂材料は、有機顔料、無機顔料、酸性染料、塩基性染料等で着色されたものであってもよい。

[0053]

被覆層3は、細胞が付着し得る材料で構成されている。このような材料としては、ポリスチレン、ポリアクリルアミド、セルロース、デキストラン等を用いることもできるが、特に、リン酸カルシウム系化合物を主材料とするものが好適である。リン酸カルシウム系化合物は、生物学的に不活性であり、細胞に対してダメージを与えるおそれが極めて低いことから好ましい。

[0054]

特に、リン酸カルシウム系化合物を主材料として被覆層3を形成することにより、磁性材料22から生じる金属イオンを被覆層3で捕捉して、培養液中に金属イオンが溶出するのを防止することもできる。これにより、細胞への悪影響を防止することができる。この場合、被覆層3は、イオンバリヤ層として機能する。

[0055]

リン酸カルシウム系化合物としては、特に限定されず、Ca/P比が1.0~2.0の各種化合物を用いることができ、例えば、 Ca_{10} (PO_4) $_6$ (OH) $_2$ 、 Ca_{10} (PO_4) $_6$ F_2 、 Ca_{10} (PO_4) $_6$ Cl_2 、 Ca_3 (PO_4) $_2$ 、 $Ca_2P_2O_7$ 、Ca(PO_3) $_2$ 、 $CaHPO_4$ 等のうちの1種または2種以上を混合して用いることができる。

[0056]

これらの中でも、リン酸カルシウム系化合物としては、ハイドロキシアパタイト(Calo(PO4)6(OH)2)を主成分とするものが最適である。ハイドロキシアパタイトは、生体材料として用いられるものであり、細胞が極めて効率よく付着することができ、かつ、細胞に対するダメージを与える可能性が特に低い。

[0057]

また、フッ素アパタイト(Ca_{10} (PO_4) $_6F_2$)を用いる場合には、全リン酸カルシウム系化合物中のフッ素含有率を、5重量%以下とするのが好ましい。全リン酸カルシウム系化合物中のフッ素含有率を、<math>5重量%以下とすること

により、被覆層 3 (細胞培養担体 1) からのフッ素の溶出が防止または極めて少量とされるので、細胞へのダメージは、無いかまたは極めて小さいものとすることができ、その結果、細胞の増殖効率が低下するのが防止される。

[0058]

なお、これらのリン酸カルシウム系化合物は、公知の湿式合成法、乾式合成法 などによって合成することができる。この場合、リン酸カルシウム系化合物中に は、その合成の際に残存する物質(原料等)または合成の過程で生じる二次反応 生成物等が含まれていてもよい。

[0059]

被覆層3を主としてリン酸カルシウム系化合物で構成する場合、この被覆層3は、磁性粒子2の表面に、リン酸カルシウム系化合物を吸着させることにより形成されたものであってもよいが、図1に示すように、磁性粒子2の表面付近に、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成された粒子31(以下、単に「粒子31」と言う。)の一部が貫入することにより形成されたものであるのが好ましい。これにより、被覆層3と磁性粒子2との密着性を優れたものとすることができる。このため、被覆層3の磁性粒子2の表面からの剥離を好適に防止すること、すなわち、細胞培養担体1の強度を優れたものとすることができる。

[0060]

また、この場合、被覆層 3 は、例えば、磁性粒子 2 の表面に、主としてリン酸カルシウム系化合物で構成された多孔質粒子(以下、単に「多孔質粒子」と言う。)を衝突させることにより形成することができる。かかる方法によれば、容易かつ確実に、被覆層 3 を形成することができる。

[0061]

磁性粒子2の表面に多孔質粒子を衝突させると、多孔質粒子は、磁性粒子2に 衝突する際に、破砕されて比較的小さい粒径の粒子31となり、その一部が磁性 粒子2に貫入する。このとき、粒子31の一部が磁性粒子2に貫入すると、磁性 粒子2は、自らの弾性力により粒子31を掴み込むようにして固定する。

[0062]

また、多孔質粒子は、リン酸カルシウム系化合物の一次粒子を凝集結合させる

ことにより製造されたものを用いるのが好ましい。このような多孔質粒子は、磁性粒子2に衝突した際に、より効率よく破砕されるので、磁性粒子2の表面をより確実に被覆することができる。

[0063]

多孔質粒子の平均粒径は、特に限定されないが、100μm以下であるのが好ましい。多孔質粒子の平均粒径が100μmを超えると、磁性粒子2への衝突時の速度が低くなり、多孔質粒子が効率よく破砕されない場合がある。

[0064]

この磁性粒子 2 と多孔質粒子との衝突は、例えば、市販のハイブリダイゼーション装置を用いて、乾式で行うことができる。このときの条件は、例えば、磁性粒子 2 と多孔質粒子との混合比が、重量比で 4 0 0 : $1\sim5$ 0 : 1 程度、装置内の温度が、磁性粒子 2 の主材料として用いた樹脂材料の軟化温度以下(通常、80 \mathbb{C} 以下)とされる。

[0065]

また、このような多孔質粒子は、例えば、次のような公知の方法で製造することができる。

[0066]

すなわち、多孔質粒子は、公知の方法で湿式合成したリン酸カルシウム系化合物の結晶粒子(一次粒子)を含むスラリーを、直接噴霧乾燥などにより二次粒子に造粒するか、または、前記スラリーに粘度調整剤、加熱により消失する有機化合物粒子または繊維等の添加物を加えて、噴霧乾燥などにより二次粒子に造粒する。なお、得られた二次粒子は、必要に応じて焼成するようにしてもよい。

[0067]

この二次粒子自体が多孔質粒子となっているので、この二次粒子をそのまま被 覆層3の形成に使用することができる。

[0068]

さらに、より高気孔率の多孔質粒子が好ましい場合には、例えば、次の方法で 製造するようにする。

[0069]

まず、前記二次粒子を再びスラリー状に懸濁して、湿式成形または加圧による 乾式成形等により、ブロック体に成形する。なお、この際、後の焼成工程で消散 して、気孔を形成するための有機化合物を添加してもよい。また、かかる有機化 合物を添加せずに、例えば焼成温度等の他の条件を調節することにより、気孔径 を制御することもできる。次いで、得られたブロック体を400~1300℃程 度の温度範囲で焼成する。焼成温度が400℃未満では、有機化合物の熱消失、 ブロック体の焼結等が充分に行われないおそれがある。一方、焼成を1300℃ を超える高温で行うと、焼結体が緻密化し過ぎたり、リン酸カルシウム系化合物 が分解を起こすおそれがある。次いで、このように焼成したブロック体を粉砕後 、分級して所望の粒径のものとする。

[0070]

この多孔質粒子の気孔径は、例えば、前記一次粒子の大きさ、スラリーの粘度 、添加物等を適宜設定することによって、調整することができる。

[0071]

このようにして得られる多孔質粒子は、その比表面積が $10m^2/g$ 以上、かつ、細孔径(気孔径)が $500\sim1000$ A程度であることが好ましい。かかる条件を満足する多孔質粒子を用いて製造される細胞培養担体1は、その表面への細胞の付着の効率、付着した細胞の増殖の効率をより向上させることができる。

[0072]

なお、被覆層3の形成方法(細胞培養担体1の製造方法)は、これに限定されるものではない。

[0073]

このような被覆層 3 は、緻密質なものまたは多孔質なもののいずれであっても よい。

[0074]

また、被覆層 3 の平均厚さは、特に限定されないが、 $0.1\sim5$ μ m程度であるのが好ましく、 $0.5\sim2$ μ m程度であるのがより好ましい。被覆層 3 の平均厚さが前記下限値未満である場合、細胞培養担体 1 では、部分的に磁性粒子 2 が露出してしまうおそれがある。一方、被覆層 3 の平均厚さが前記上限値を超えた

場合、細胞培養担体1の密度の調整が困難となる。

[0075]

このような細胞培養担体1は、磁場を与えることにより容易に移動可能であり、また、磁場を取り除いたときには培養液中で沈降(沈殿) し得るものであるのが好ましい。これにより、培養液をより容易かつ確実に攪拌することができる。

[0076]

かかる観点からは、細胞培養担体1の密度(比重)は、0.8~2.5 g/c m³程度であるのが好ましく、1.0~1.2 g/c m³程度であるのがより好ましい。細胞培養担体1の密度が小さ過ぎると、磁場を取り除いた際に、細胞培養担体1が培養液中で沈降し難くなり、一方、細胞培養担体1の密度が大き過ぎると、細胞培養担体1を培養液中で移動させるのに大きな磁場が必要となり、いずれの場合も、培養液の撹拌を十分に行えないおそれがある。

[0077]

また、細胞培養担体1の大きさ(サイズ)も、特に限定されないが、例えば、 次のようなものが好ましい。

[0078]

すなわち、細胞培養担体 1 の平均粒径を A $[\mu m]$ とし、細胞培養担体 1 に付着させる細胞の最大長さを B $[\mu m]$ としたとき、A / B が 2 \sim 1 0 0 程度であるのが好ましく、5 \sim 5 0 程度であるのがより好ましい。これにより、細胞培養担体 1 の表面積を細胞の大きさ(サイズ)に対して十分に大きくすることができるため、細胞が細胞培養担体 1 の表面に付着、増殖するのがより容易となる。

[0079]

具体的には、細胞培養担体1の平均粒径は、 $50\sim500$ μ m程度であるのが 好ましく、 $100\sim300$ μ m程度であるのがより好ましい。これにより、前記 効果をより向上させることができる。

[080]

以上説明したような細胞培養担体1は、その表面により多くの細胞を付着させ、増殖させる観点からは、本実施形態のように、磁性粒子2の表面のほぼ全てが 被覆層3で覆われているのが好ましいが、付着させる細胞の種類や、磁性粒子2 の構成材料(樹脂材料)の種類等によっては、その表面の一部が被覆層3で覆われたような構成(換言すれば、磁性粒子2の一部が被覆層3から露出する構成)であってもよい。

[0081]

次に、このような細胞培養担体1を用いて、細胞の培養を行う細胞培養装置 (本発明の細胞培養装置) について説明する。

[0082]

<第1実施形態>

まず、本発明の細胞培養装置の第1実施形態について説明する。

[0083]

図2は、本発明の細胞培養装置の第1実施形態を示す模式図、図3は、磁場発生装置が発生する磁場のパターンを示す図である。

[0084]

図2に示す細胞培養装置100は、培養容器110と、磁場発生装置120と、コントローラ(制御部)130と、加温装置150とを有している。コントローラ130が電源に接続されることにより、細胞培養装置100の各部の作動に必要な電力が供給される。

[0085]

培養容器110は、培養液140を収納するものであり、上部に培養液140を供給・排出するための開口部111が形成されている。この開口部111は、必要に応じて栓体112によって閉塞され、培養容器110内の気密性が保たれるようになっている。

[0086]

培養容器110の形状、容量等は、特に限定されず、用いる細胞の種類、培養 液140の種類等に応じて適宜設定される。

[0087]

磁場発生装置120は、培養液140中で細胞培養担体1を移動させるための磁場を発生するものであり、電磁石121と、この電磁石121を収納する非磁性体カバー(図示せず)とを有している。

[0088]

本実施形態では、電磁石121は、金属製の環状の芯材122と、この芯材122の外周部にラセン状に巻回された導線123とで構成され、導線123に通電することにより周辺に磁場を発生する。

[0089]

非磁性体カバーは、電磁石121を保護、固定する機能を有するものであり、 例えば、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂等の各種樹脂材料等で構成されてい る。

[0090]

このような磁場発生装置120の内側には、培養容器110が設けられている。換言すれば、磁場発生装置120は、培養容器110の外周部に設けられている。なお、磁場発生装置120は固定部材(図示せず)により、固定・保持されている。磁場発生装置120の培養容器110の高さ方向における設置位置は、培養液140を培養容器110内に収納(貯留)したときに、培養液140の液面付近とするのが好ましい。これにより、細胞培養担体1を上下方向に大きく移動させることができ、培養液140をより均一に撹拌することができる。

[0091]

また、磁場発生装置120と培養容器110との離間距離(図2中d)は、特に限定されないが、磁場発生装置120と培養容器110とができるだけ接近しているのが好ましく、特に、これらが接触(密着)して設けられているのが好ましい。

[0092]

磁場発生装置120は、発生する磁場の強度を経時的に変化させるよう構成されている。この磁場発生装置120が発生する磁場のパターンとしては、例えば、一定間隔でオン/オフするパターン(図3(a)参照)が挙げられる。磁場を発生させると、細胞培養担体1が磁場発生装置120側に引き寄せられ、培養液140中で浮上する。また、この状態から磁場の発生を停止すると、磁場発生装置120側に引き寄せられた細胞培養担体1がその自重によって沈降する。このような細胞培養担体1の上下移動の繰り返しにより培養液140には乱流が生じ

、培養液140が均一かつ緩やかに撹拌される。

[0093]

磁場の最大強度(絶対値)は、細胞培養担体1の密度(比重)、培養液140の組成や容積等に応じて適宜設定され、特に限定されないが、0.1~100W b/m²程度であるのが好ましく、0.2~50Wb/m²程度であるのがより好ましい。磁場の最大強度(磁束密度)が小さ過ぎると、細胞培養担体1を磁場発生装置120側に十分に引き寄せることが困難となり、培養液140の撹拌が不十分になるおそれがある。また、磁場の最大強度を前記上限値を超えて大きくしても、消費電力が無駄にかかるばかりか、磁場が細胞へ悪影響を及ぼすおそれがある。

[0094]

なお、磁場発生装置 1 2 0 が発生する磁場のパターンは、一定間隔でオン/オフするパターン(図 3 (a)参照)に限らず、例えば、発生する磁場の強度を一定間隔で増減させるパターン(図 3 (b)参照)、発生する磁場の強度や向き等を連続的に変化させるパターン(図 3 (c)参照)等であってもよい。また、これらのパターンは、任意に組み合わせるようにしてもよい。

[0095]

コントローラ130は、電源から供給される電流の条件(例えば、種類、量、方向、時間、周波数等)を変化させる機能を有するものである。そして、コントローラ130は、電源から供給される電流を変換して、所定の条件(パターン)の電流を電磁石121(磁場発生装置120)に供給する。例えば、磁場発生装置120に間欠的に磁場を発生させる場合、電源から供給される交流電流をパルス電流に変換し、電磁石121に供給する。

[0096]

また、コントローラ130には、加温装置150が電気的に接続されている。 この加温装置150は、例えば、ヒータ、ペルチェ素子等が内蔵されており、コントローラ130の制御により培養液140を加温する。

[0097]

次に、このような細胞培養装置100の使用方法(本発明の細胞培養方法)の

一例を説明する。

[0098]

[1] まず、細胞培養担体1に、それぞれ滅菌処理を施す。これにより、細胞培養担体1の表面に存在する微生物やカビ等の数を低減、または、これらを完全に死滅させることができる。これにより、微生物やカビ等による細胞へのダメージが低減または除去され、細胞は、より効率よく増殖することができる。

[0099]

この滅菌処理には、例えば、細胞培養担体1と滅菌液とを接触させる方法、オートクレーブ滅菌、ガス滅菌、放射線滅菌等を用いることができるが、これらの中でも、細胞培養担体1と滅菌液とを接触させる方法が好適である。かかる方法によれば、大量の細胞培養担体1を、より効率よく滅菌することができる。

[0100]

滅菌液を用いる場合、滅菌処理後の細胞培養担体1を洗浄して、その表面に付 着した滅菌液を除去する。

[0101]

[2] 次に、前記工程[1]終了後の細胞培養担体1と、細胞(付着させる 細胞)とを培養液140に添加(混合)し、この培養液140を、細胞培養装置 100の培養容器110内に収納(貯留)する。

[0102]

ここで、細胞には、例えば、目的とするタンパク質をコードする遺伝子を含む シャトルベクター (ベクター) を移入しておくようにする。

[0103]

この細胞としては、例えば、動物細胞、植物細胞、細菌、ウイルス等が挙げられるが、これらの中でも、特に、動物細胞が好適である。細胞として動物細胞を用いることにより、本発明をより広範な技術分野へ適用することが可能となるとともに、タンパク質の生産を行う場合には、より複雑な構造を有するもの(例えば、糖タンパク質等)の生産を好適に行うことができる。

[0104]

培養液140は、用いる細胞の種類等により適宜選択され、特に限定されない

が、例えば、ダルベッコMEM培地、ニッスイMEM培地、BME培地、MCDB-104培地等を用いることができる。

[0105]

また、これらの培養液140中には、必要に応じて、例えば、血清、アルブミン等の血清タンパク質、各種ビタミン類、アミノ酸、塩類等の添加剤を添加するようにしてもよい。

[0106]

[3] 次に、細胞培養装置100を作動させると、前述のようにして培養液140には、磁場発生装置120から所定のパターンの磁場が与えられる(印加される)。これにより、培養液140中で細胞培養担体1が移動し、この細胞培養担体1の移動により培養液140が攪拌されるとともに、細胞培養担体1は、培養液140中に均一に懸濁される。

[0107]

また、このとき、加温装置150により培養液140は加温される。この培養液140の加温の温度は、培養する細胞の種類等に応じて適宜設定され、特に限定されないが、通常、4~40℃程度、好ましくは25~37℃程度とされる。

[0108]

このような状態で、培養液 1 4 0 中では、細胞が細胞培養担体 1 の表面に付着し、その表面で増殖する。特に、細胞培養担体 1 の移動による培養液 1 4 0 の攪拌は、均一かつ緩やかに行われるため、細胞の培養を極めて効率よく行うことができる。

[0109]

そして、増殖した細胞は、目的とするタンパク質を生産(産生)して、このタンパク質を、例えば培養液140中へ放出したり、細胞内に蓄積したり等する。

[0110]

なお、このとき、必要に応じて、酸素ガスを含むガスを供給しつつ、細胞の培養を行うようにしてもよい。

[0111]

[4] 次に、生産されたタンパク質を回収する。例えば、培養液140中に

放出されたタンパク質を回収する場合には、次のようにすることができる。

[0112]

すなわち、前記工程 [3] における培養液 140の攪拌を停止して、細胞培養 担体 1 が培養液 140中で沈殿した後上清を採取するか、磁石を用いて細胞培養 担体 1を回収した後、培養液 140を採取するか、または、培養液 140を濾過 して濾液を採取する。そして、この採取液(上清または濾液)を処理(例えば、 クロマトグラフィー等)することにより、目的とするタンパク質を容易に回収す ることができる。

[0113]

<第2実施形態>

次に、本発明の細胞培養装置の第2実施形態について説明する。

[0114]

図4は、本発明の細胞培養装置の第2実施形態を示す模式図である。

以下、第2実施形態について説明するが、前記第1実施形態との相違点を中心 に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。

[0115]

図4に示す細胞培養装置100では、磁場発生装置120の構成が異なり、それ以外は、前記第1実施形態の細胞培養装置100と同様である。

[0116]

すなわち、第2実施形態の磁場発生装置120は、直線状(円柱状)の芯材122の外周部にラセン状に導線123が巻回されてなる電磁石121を有している。なお、磁場発生装置120は、磁場に影響を与えない材料を主材料として構成される防水カバーで覆うことが好ましい。

[0117]

この磁場発生装置120は、培養容器110に装着される栓体112に挿通された状態で、固定(固着)されている。そして、本実施形態では、細胞の培養を行う際に、磁場発生装置120は、培養液140に接触するように設置される。

[0118]

磁場発生装置120が発生する磁場のパターンは、例えば、前述した図3に示

すパターンとすることができる。

[0119]

このような第2実施形態の細胞培養装置100においても、前記第1実施形態と同様の作用・効果が得られる。

[0120]

<第3実施形態>

次に、本発明の細胞培養装置の第3実施形態について説明する。

[0121]

図5は、本発明の細胞培養装置の第3実施形態を示す模式図、図6は、磁場発生装置が発生する磁場のパターンを示す図である。

[0122]

以下、第3実施形態について説明するが、前記第1実施形態との相違点を中心 に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。

[0123]

図5に示す細胞培養装置100では、磁場発生装置120の構成が異なり、それ以外は、前記第1実施形態の細胞培養装置100と同様である。

[0124]

すなわち、第3実施形態の磁場発生装置120は、4つ(複数)の電磁石12 1A~121Dを備えている。

[0125]

そして、各電磁石121A~121Dは、培養容器110の周方向に沿って、 ほぼ等間隔で設けられている。

[0126]

このような構成により、通電する電磁石121A~121Dを順次切り替えると、すなわち、発生する磁場の位置を経時的に変化させると、細胞培養担体1の培養液140中での移動をより複雑なパターンとすることができる。これにより、細胞培養担体1を培養液140中でより均一に懸濁させることができ、その結果、細胞をより効率よく増殖させることができる。

[0127]

各電磁石121A~121Dが発生する磁場のパターン(各電磁石121A~121Dへの通電の切替)は、例えば、図6に示すようにすることができる。すなわち、1つの電磁石が磁場を発生している間は、他の電磁石は磁場を発生しないようにし、磁場を発生する電磁石を順次(同期させて)切り替えていく。これにより、細胞培養担体1を培養容器110の内面に沿って移動させることができる。

[0128]

なお、各電磁石121A~121Dが発生する磁場のパターンは、図6に示す ものに限定されず、例えば、図2に示すようなパターンを任意に組み合わせたも のであってもよい。

[0129]

また、各電磁石121A~121Dは、互いに、例えば導線123の巻回数、 全体形状、大きさ等が同じであってもよく、異なっていてもよい。

[0130]

このような第3実施形態の細胞培養装置100においても、前記第1実施形態 と同様の作用・効果が得られる。

[0131]

以上、本発明の細胞培養担体、細胞培養方法および細胞培養装置について説明 したが、本発明は、これらに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機 能を発揮する任意の構成のものに置換することができ、また、任意の構成を付加 することもできる。

[0132]

例えば、各前記実施形態では、磁場発生装置は、電磁石を備える構成のものであったが、電磁石に代えて永久磁石を用いてもよい。この場合、例えば、永久磁石を培養容器に対して移動させる移動機構を設け、この永久磁石の移動操作により培養液中の磁性粒子を移動させるようにすることができる。また、この場合、永久磁石の移動は、上下、左右、斜め、回転等を任意に組み合わせることができる。また、各前記実施形態の任意の2以上の構成を組み合わせるようにしてもよい。

[0133]

また、各前記実施形態では、磁場発生装置が固定された構成のものであったが、本発明では、磁場発生装置と培養容器とが相対的に移動可能に設けられ、培養液へ与える磁場の位置を経時的に変化させる構成であってもよい。このような構成としては、磁場発生装置を培養容器に対して、例えば、上下方向へ、左右方向へ、接近離間させる方向へ、周方向に沿って、または、これらを組み合わせて移動させる構成等が挙げられる。

[0134]

さらに、本発明では、磁場発生装置は、前述したようなパターンで培養液へ与える磁場の強度を経時的に変化させるとともに、培養容器に対して相対的に移動可能に設けられ、培養液へ与える磁場の位置を経時的に変化させる構成とされていてもよい。

[0135]

また、本発明の細胞培養方法では、必要に応じて、他の細胞培養担体を併用することもできる。他の細胞培養担体としては、例えば、ポリスチレン、ポリアクリルアミド、セルロース、デキストラン等を主材料とするもの、主として樹脂材料で構成された基材の表面を、細胞が付着し得る材料で被覆したもの等が挙げられる。

[0136]

【実施例】

次に、本発明の具体的実施例について説明する。

[0137]

1. 細胞培養担体の用意

[細胞培養担体A]

まず、平均粒径 150μ m、密度1.90g/cm3のフェライト複合化ナイロン粒子50gと、Ca/P比1.67、平均粒径 10μ mハイドロキシアパタイト粒子(一次粒子が凝集結合した多孔質粒子)0.25gとを用意した。

[0138]

なお、ハイドロキシアパタイト粒子は、その比表面積が45m2/g、かつ、

その細孔径が600点であった。

[0139]

次に、これらフェライト複合化ナイロン粒子およびハイドロキシアパタイト粒子をNARAハイブリダイゼーションシステムNHS-1 ((株) 奈良機械製作所製、定格動力 5.5 kW、定格電流 23A)に投入し、この装置を 6400回転/分、32~50℃で5分間稼動させた。これにより、表面がハイドロキシアパタイトで被覆された細胞培養担体A (図1参照)を得た。

[0140]

なお、得られた細胞培養担体Aは、平均粒径 $151\mu m$ (ハイドロキシアパタイト被覆層の平均厚さ $1.0\mu m$)、密度 $1.92g/cm^3$ であった。

[0141]

「細胞培養担体B〕

まず、平均粒径 150μ m、密度 1.02 g / c m 3 のナイロン粒子(基材) 50 g と、C a / P比 1.67、平均粒径 10μ mのハイドロキシアパタイト粒子(一次粒子が凝集結合した多孔質粒子) 0.25 g とを用意した。

[0142]

なお、ハイドロキシアパタイト粒子は、その比表面積が $45 \text{ m}^2/\text{g}$ 、かつ、その細孔径が600 Åであった。

[0143]

次に、これらナイロン粒子およびハイドロキシアパタイト粒子をNARAハイブリダイゼーションシステムNHS-1 ((株) 奈良機械製作所製、定格動力 5 . 5 k W、定格電流 2 3 A) に投入し、この装置を 6 4 0 0 回転/分、 3 2 \sim 5 0 $\mathbb C$ $\mathbb C$

[0144]

なお、得られた細胞培養担体Bは、平均粒径 $151\mu m$ (ハイドロキシアパタイト被覆層の平均厚さ $1\mu m$)、密度 $1.03g/cm^3$ であった。

[0145]

[細胞培養担体C]

細胞培養担体Cとして、平均粒径200 μ m、密度1.03g/cm 3 のデキストラン粒子(ファルマシア社製)を用意した。

[0146]

2. 細胞の培養

2-1. ヒト骨肉腫由来細胞 (HOS) の培養

このヒト骨肉腫由来細胞は、最大長さが約20μmの細胞である。

[0147]

(実施例1A)

細胞培養担体A:1.5 g と、 2×10^5 個/mLのヒト骨肉腫由来細胞(HOS)懸濁液:30 m L とを、ニッスイMEM培地(培養液)100 m L に添加した。なお、ニッスイMEM培地中には、10 v o 1 %のウシ胎児血清を添加して用いた。

[0148]

この培養液を、図2に示すような細胞培養装置の培養容器(IWAKI-PY REX社製、耐熱広口ガラス瓶)に収納して、細胞の培養を行った。なお、培養条件は、発生する磁場のパターン:図3 (a)、パルス間隔:2秒、培養液の温度:37℃、培養の日数:5日間とした。

[0149]

(実施例2A)

パルス間隔を10秒とした以外は、前記実施例1Aと同様にして、細胞の培養を行った。

[0150]

(実施例3A)

細胞培養担体A:1.5gに代えて、細胞培養担体A:0.6gと細胞培養担体B:0.8gとを用いた以外は、前記実施例1Aと同様にして、細胞の培養を行った。

[0151]

(実施例4A)

細胞培養担体A:1.5gに代えて、細胞培養担体A:0.6gと細胞培養担

体C:0.8gとを用いた以外は、前記実施例1Aと同様にして、細胞の培養を行った。

[0152]

(比較例 1 A)

細胞培養担体B:1.5 gと、 2×10^5 個/mLのヒト骨肉腫由来細胞(HOS)懸濁液:30mLとを、ニッスイMEM培地(培養液)100mLに添加した。なお、ニッスイMEM培地中には、10vol%のウシ胎児血清を添加して用いた。

[0153]

この培養液を、スピンナーフラスコ(柴田科学社製)に収納して、細胞の培養を行った。なお、培養条件は、撹拌子の回転速度:30 r p m、培養液の温度:37℃、培養の日数:5日間とした。

[0154]

(比較例 2 A)

攪拌子の回転速度を60rpmとした以外は、前記比較例1Aと同様にして、細胞の培養を行った。

[0155]

(比較例 3 A)

細胞培養担体Bに代えて、細胞培養担体Cを用いた以外は、前記比較例1Aと同様にして、細胞の培養を行った。

[0156]

2-2. サル腎臓由来細胞(Vero)の培養

このサル腎臓由来細胞は、最大長さが約20 μmの細胞である。

[0157]

(実施例1B~4B、比較例1B~3B)

サル腎臓由来細胞を用いた以外は、それぞれ、前記実施例1A~4Aおよび比較例1A~3Aと同様にして、細胞の培養を行った。

[0158]

2-3. 蚊由来細胞(C6/36)の培養

この蚊由来細胞は、最大長さが約20μmの細胞である。

[0159]

(実施例1C~4C、比較例1C~3C)

蚊由来細胞を用いた以外は、それぞれ、前記実施例 1 A ~ 4 A および比較例 1 A ~ 3 A と同様にして、細胞の培養を行った。

[0160]

3. 評価

各実施例および各比較例において、それぞれ、培養開始(撹拌開始)から3時間後、1日後、3日後、5日後に、各培養液の所定量を採取し、細胞培養担体(15mg)の表面に付着している細胞の数を計測した。この細胞数の計測は、EDTAまたはトリプシン処理した細胞をトリパンブルー染色することにより行った。

その結果を、表1~表3に示す。

[0161]

【表1】

表1(ヒト骨肉腫由来細胞(HOS))

	細胞培養担体	細胞数 [×10⁵個/mL]			
	和100年安旦中	3時間後	1日後	3日後	5日後
実施例1A	A	0.9	4. 0	9.8	9. 9
実施例2A	A	0.9	4. 2	9. 9	10.1
実施例3A	A + B	1. 0	4. 5	10.1	11.0
実施例4A	A + C	1. 0	4. 8	10.2	10.8
比較例1A	В	0.6	3. 9	5. 5	6.1
比較例2A	В	0.4	0.6	0.5	0.3
比較例3A	С	0.9	4. 2	5.8	6.5

[0162]

【表2】

表2 (サル腎臓由来細胞(Vero))

	細胞培養担体	細胞数 [×105個/mL]			
•		3 時間後	1日後	3日後	5日後
実施例1B	A	1. 0	2. 9	6.0	9.8
実施例2B	A	0.9	3. 0	6. 0	9. 9
実施例3B	A + B	1. 0	3. 5	6.5	11.5
実施例 4 B	A + C	1. 0	3.4	7.0	11.1
比較例1B	В	0.6	3. 1	5. 5	6.5
比較例2B	В	0.5	0.4	0.1	0.1
比較例3B	С	0.9	3. 0	5.8	7. 0

[0163]

【表3】

表3(蚊由来細胞(C6/36))

	細胞培養担体	細胞数 [×10 ⁵ 個/mL]			
	柳龙石 笼1旦径	3 時間後	1日後	3日後	5日後
実施例10	A	0.8	2. 5	5.6	8.3
実施例2C	A	0.6	3. 2	5.8	8. 5
実施例3C	A + B	0.9	4. 2	8.0	9. 2
実施例40	A + C	1.0	4. 5	8.3	9.8
比較例1C	В	0.4	2. 5	4.8	5. 2
比較例2C	В	0.1	0.08	0.04	0.01
比較例3C	С	0.6	2. 5	5.0	5.9

[0164]

各表に示すように、各実施例(本発明)では、いずれも、細胞の種類によらず 、各比較例に対して、細胞の培養効率が高いことが明らかとなった。

[0165]

また、実施例(本発明)では、磁場の発生パターンのパルス間隔を変更した場合でも、細胞の増殖効率に大きな変動は、認められなかった。このことから、実施例では、細胞の種類等に応じた培養条件の厳密な設定を要しないことが判る。

[0166]

これに対して、スピンナーフラスコを用いる培養である比較例では、攪拌子の 回転速度の違いにより、細胞の培養効率が大きく変動するものであった。すなわ ち、比較例では、いずれの細胞も、その育成状態が攪拌子の回転速度の違いにより大きく異なるものであった。このため、培養条件の最適化が極めて難しいことが判る。

また、比較例では、細胞培養担体からの細胞の脱落も認められた。

[0167]

なお、図2、図4および図5に示すような細胞培養装置を用いて、磁場のパターンを種々変更して、各前記実施例と同様にして細胞の培養を行ったが、前記と同様の結果が得られた。

[0168]

【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば、培養液を均一かつ緩やか(マイルド)に 撹拌することができ、細胞を効率よく増殖させることができる。

[0169]

また、細胞培養担体の構成を適宜設定することにより、前記効果をより向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の細胞培養担体の実施形態を示す断面図である。

図2

本発明の細胞培養装置の第1実施形態を示す模式図である。

【図3】

磁場発生装置が発生する磁場のパターンを示す図である。

【図4】

本発明の細胞培養装置の第2実施形態を示す模式図である。

【図5】

本発明の細胞培養装置の第3実施形態を示す模式図である。

【図6】

磁場発生装置が発生する磁場のパターンを示す図である。

【符号の説明】

1	細胞培養担体
2	磁性粒子
2 1	基材
2 2	磁性材料
3	被覆層
3 1	粒子
1 0 0	細胞培養装置
1 1 0	培養容器
1 1 1	開口部
1 1 2	栓体
1 2 0	磁場発生装置
1 2 1	電磁石
1 2 1 A ~ 1 2 1	D 電磁石
1 2 2	芯材
1 2 3	導線
1 3 0	コントローラ
1 4 0	培養液

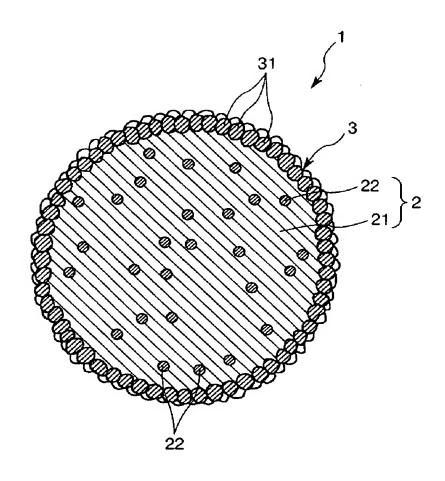
加温装置

1 5 0

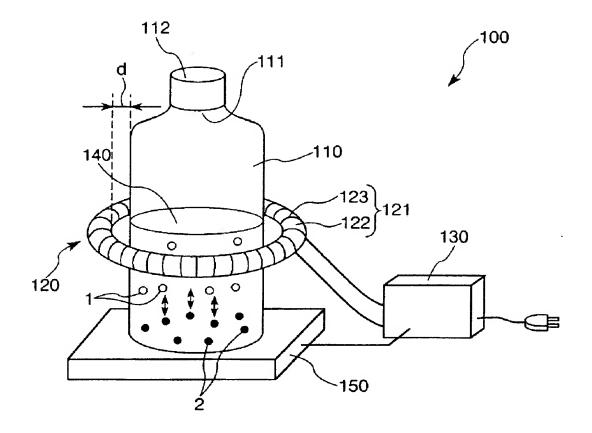
【書類名】

図面

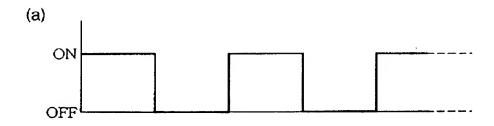
【図1】

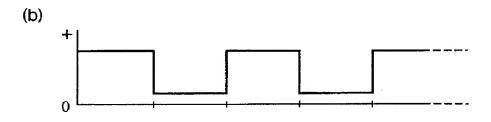


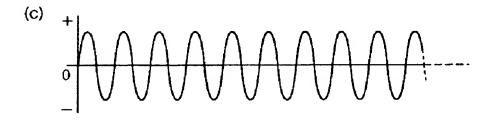
【図2】



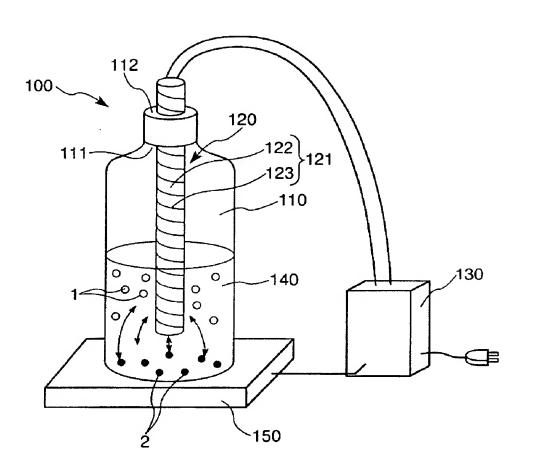
【図3】



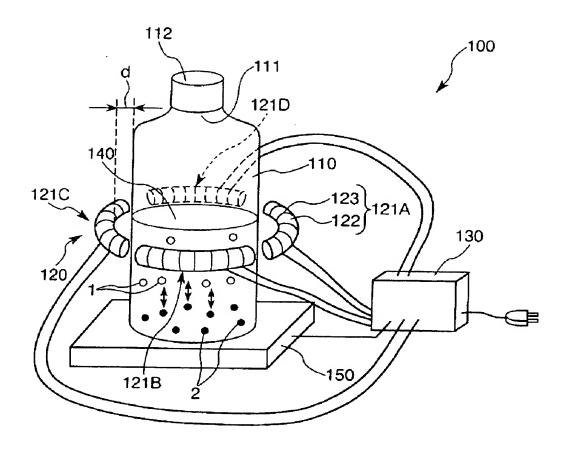




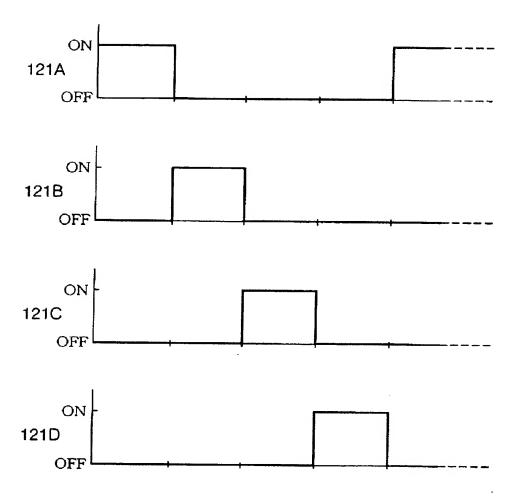
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】均一かつ緩やか(マイルド)に培養液を撹拌することができ、細胞を効率よく付着、増殖させることができる細胞培養担体、かかる細胞培養担体を用いる細胞培養方法および細胞培養装置を提供すること。

【解決手段】本発明の細胞培養装置100は、細胞と細胞培養担体1とを含む培養液140を収納する培養容器110と、培養液140中で細胞培養担体1を移動させるための磁場を発生する磁場発生装置120と、コントローラ130と、加温装置150とを有している。この細胞培養装置100では、培養液140へ磁場を与え、培養液140中で細胞培養担体1を移動させることにより、培養液140を撹拌するとともに、細胞を細胞培養担体1の表面に付着させ、増殖させる。

【選択図】図2

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-107143

受付番号

5 0 3 0 0 5 9 8 4 3 2

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0 0 9 5

作成日

平成15年 4月11日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 4月10日

特願2003-107143

出願人履歴情報

識別番号

[000000527]

1. 変更年月日 [変更理由]

2002年10月 1日 名称変更

住所

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

氏 名 ペンタックス株式会社